

デュアルハイパワーレーザー用反射防止膜

＊技術概要

近年、レーザーの高出力化が進む中、より高いレーザー損傷耐性を持つ光学素子が求められています。伊藤光学工業では基板の表面状態や成膜材料及び成膜条件の最適化を行うことで、レーザー耐性の優れた反射防止膜の加工を実現しております。

＊技術特徴

- ・使用波長：1064nm/532nm
- ・高透過率： $T \geq 99.5\%$
- ・損傷閾値：38 J/cm² / 19 J/cm²
- ・対応基板：合成石英、BK7、CaF₂

レーザー損傷試験結果

波長	パルス幅	照射角度	偏光	ビーム径	評価方法	損傷閾値
1064nm	10ns	0°	N	X410μm Y410μm	1-on-1	38 J/cm ²
532nm	8ns	0°	N	X320μm Y350μm	1-on-1	19 J/cm ²

* 上記データは参考値であり保証値ではありません。

光学分光特性

